

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2014 年 10 月 2 日(02.10.2014)



(10) 国際公開番号

WO 2014/156404 A1

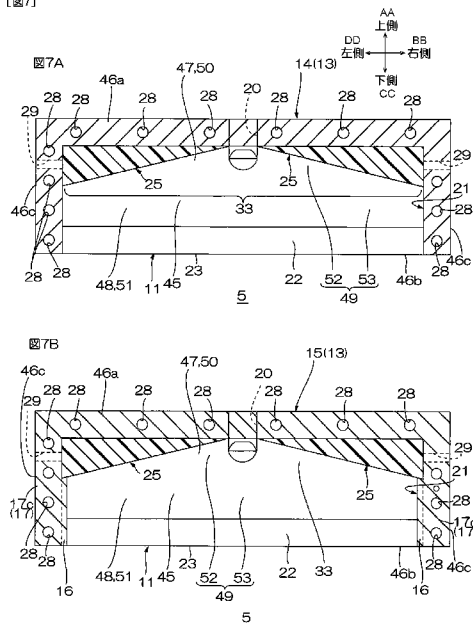
- (51) 国際特許分類:
B05C 5/02 (2006.01) H01M 4/04 (2006.01)
B05C 11/10 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2014/054215
- (22) 国際出願日: 2014 年 2 月 21 日(21.02.2014)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2013-066023 2013 年 3 月 27 日(27.03.2013) JP
- (71) 出願人: 日東電工株式会社(NITTO DENKO CORPORATION) [JP/JP]; 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 塚原 大祐(TSUKAHARA, Daisuke); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 杉浦 紳介(SUGIURA, Shinsuke); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP). 鵜飼 貴司(UGAI, Takashi); 〒5678680 大阪府茨木市下穂積 1 丁目 1 番 2 号 日東電工株式会社内 Osaka (JP).
- (74) 代理人: 岡本 寛之, 外(OKAMOTO, Hiroyuki et al.); 〒5320003 大阪府大阪市淀川区宮原 4 丁目 5 番 3 6 号 セントラル新大阪ビル 3 F いくみ特許事務所内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[続葉有]

(54) Title: COATING DEVICE

(54) 発明の名称: 塗布装置

[図7]



AA... TOP SIDE
BB... RIGHT SIDE
CC... BOTTOM SIDE
DD... LEFT SIDE

(57) Abstract: This coating device (1) is for applying a varnish which includes particles and a resin. The coating device (1) is equipped with a manifold (21) for spreading the varnish in a first direction which is perpendicular to the discharge direction, and a discharge unit (23) for discharging the varnish spread in the first direction by the manifold (21). The manifold (21) is provided with an expanding section (33) in which the first direction length thereof gradually becomes longer toward the downstream side in the discharge direction. The discharge unit (23) is provided with discharge restricting sections (16) for relatively restricting the discharge of the varnish at the first direction ends of the discharge unit (23).

(57) 要約: 塗布装置 (1) は、粒子および樹脂を含むワニス塗布するための塗布装置 (1) である。塗布装置 (1) は、ワニスを、吐出方向と直交する第 1 方向に広げるためのマニホールド (21) と、マニホールド (21) によって第 1 方向に広げられたワニスを吐出するための吐出部 (23) とを備える。マニホールド (21) には、第 1 方向長さが、吐出方向下流側に向かうに従って、次第に長くなる拡大部 (33) が設けられる。吐出部 (23) には、吐出部 (23) の第 1 方向端部におけるワニスの吐出を相対的に抑制するための吐出抑制部 (16) が設けられている。

WO 2014/156404 A1



(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR),

OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

明 細 書

発明の名称 : 塗布装置

技術分野

[0001] 本発明は、塗布装置、詳しくは、粒子および樹脂を含むワニス塗布するための塗布装置に関する。

背景技術

[0002] 従来、樹脂を含むワニス塗布するための塗布装置が種々知られている。

[0003] また、ワニス塗布が非ニュートン流体である場合、あるいは、ワニス塗布が塗布される基材との親和性が低い場合には、塗膜の両端部が中央部に比べて盛り上がる盛り上がり部分を生じる場合がある。このような盛り上がり部分は、上記した塗膜の平坦性を損なう。

[0004] 例えば、塗布基材に塗布液を供給するためのスロットが形成されたスロットダイを備え、スロットが塗布基材に対向し、塗布基材に対向するスロットの断面が、その両端部において塗布液の供給を相対的に抑制する形状に形成されるスロットダイ塗布装置が提案されている（例えば、下記特許文献1参照）。

先行技術文献

特許文献

[0005] 特許文献1：特開2004-305955号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0006] しかし、粒子をさらに含むワニス塗布を、特許文献1に記載のスロットダイ塗布装置で塗布すると、スロットの両端部において、吐出流れが低下することから、スロットダイのマニホールドの両端部において、吐出圧が低下するので、ワニスの流れが著しく緩慢になる。そのため、ワニス塗布が滞留し易く、そのようなワニス塗布の滞留部分では、粒子の比重が相対的に大きいと、粒子が沈降する。そのため、滞留部分における粒子の分布が不均一、さらには

、マニホールドにおける粒子の分布が不均一になり易いという不具合がある。
その結果、塗膜における粒子の分布が不均一になるという不具合がある。

[0007] 本発明の目的は、塗膜の平坦性を確保しながら、塗膜における粒子の均一性を確保することのできる塗布装置を提供することにある。

課題を解決するための手段

[0008] 上記目的を達成するために、本発明の塗布装置は、粒子および樹脂を含むワニスを塗布するための塗布装置であり、ワニスを、吐出方向と直交する第1方向に広げるためのマニホールドと、前記マニホールドによって前記第1方向に広げられたワニスを吐出するための吐出部とを備え、前記マニホールドには、前記第1方向長さが、前記吐出方向下流側に向かうに従って、次第に長くなる拡大部が設けられ、前記吐出部には、前記吐出部の前記第1方向端部における前記ワニスの吐出を相対的に抑制するための吐出抑制部が設けられていることを特徴としている。

[0009] この装置では、吐出抑制部によって、吐出部の第1方向端部におけるワニスの吐出を相対的に抑制することができる。そのため、塗膜の第1方向端部における盛り上がり抑制して、塗膜の平坦性を確保することができる。

[0010] 一方、この塗布装置では、吐出部の第1方向端部において、ワニスの吐出流れが低下すると、マニホールドを通過するワニスは、拡大部において、吐出方向下流側に向かうに従って、第1方向外側に次第に広げられるので、ワニスが粒子を含むことに起因するワニスの吐出流れが緩慢になることを防止し、ワニスの滞留が生じることを防止することができる。その結果、マニホールドにおいてワニスにおける粒子の不均一性を解消することができる。従って、得られる塗膜の平坦性を確保しながら、塗膜における粒子の均一性を十分に確保することができる。

[0011] また、本発明の塗布装置では、前記マニホールドは、ワニスが入り、前記吐出方向に対する直交方向に沿う開口断面積が、前記吐出方向下流側に向かうに従って拡大する流入部と、前記流入部の前記吐出方向下流側に設けられ、ワニスが前記流入部から流出され、前記直交方向に沿う開口断面積が

、前記吐出方向に向かうに従って縮小する流出部とを備え、前記拡大部は、前記流入部に設けられていることが好適である。

[0012] マニホールドにおいて、直交方向に沿う開口断面積が吐出方向下流側に向かうに従って拡大する流入部では、直交方向に沿う開口断面積が吐出方向に向かうに従って縮小する流出部に比べて、上記したワニスの吐出流れが緩慢になり易く、それに起因するワニスの滞留を生じ易い。

[0013] しかし、この塗布装置では、拡大部が流入部に設けられているので、上記したワニスの吐出流れが緩慢になることを防止して、ワニスの滞留が生じることを防止することができる。

[0014] また、本発明の塗布装置には、前記拡大部を区画するための、前記マニホールドに対して着脱可能なアタッチメント部材が、前記マニホールドの前記吐出方向上流側における前記第1方向端部に設けられていることが好適である。

[0015] この塗布装置によれば、アタッチメント部材が、マニホールドに対して着脱可能であるので、ワニスの特性に応じて、所望形状のアタッチメント部材に交換することができる。

[0016] また、本発明の塗布装置は、前記拡大部を通過するワニスを目視することのできる透明部材を備えていることが好適である。

[0017] この塗布装置によれば、透明部材を介して、拡大部を通過するワニスを目視することができるので、ワニスにおける粒子の状態を簡単に検査することができる。

発明の効果

[0018] 本発明の塗布装置によれば、得られる塗膜における粒子の均一性を十分に確保することができる。

図面の簡単な説明

[0019] [図1]図1は、本発明の塗布装置の一実施形態の斜視図を示す。

[図2]図2は、図1の塗布装置のノズルの平面図を示す。

[図3]図3は、図2のノズルの底面図を示す。

[図4]図4は、図2のノズルの側面図を示す。

[図5]図5は、図2のノズルのA－A線に沿う側断面図を示す。

[図6]図6は、図2のノズルのB－B線に沿う側断面図を示す。

[図7]図7A－7Bは、図2のノズルの正断面図であり、図7Aは、第2シムを省略して、第1シムを表す正断面図、図7Bは、第2シムを表す正断面図を示す。

[図8]図8は、図2のノズルの分解斜視図を示す。

[図9]図9は、図2のノズルの分解側断面図を示す。

[図10]図10は、図5に示すノズルによってワニスを塗布する状態を示す。

[図11]図11は、本発明の塗布装置の他の実施形態のノズルの底面図を示す。

[図12]図12は、本発明の塗布装置の他の実施形態のノズルの底面図を示す。

[図13]図13は、本発明の塗布装置の他の実施形態のノズルの底面図を示す。

[図14]図14は、本発明の塗布装置の他の実施形態のノズルの正断面図を示す。

[図15]図15は、実施例1の塗布装置のノズルのワニスの写真の画像処理図を示す。

[図16]図16は、比較例1の塗布装置のノズルのワニスの写真の画像処理図を示す。

発明を実施するための形態

[0020] 図1～図10を参照して、本発明の塗布装置の一実施形態について説明する。

[0021] 図2において、紙面左右方向を「左右方向」（第1方向あるいは幅方向）とし、紙面上下方向を「前後方向」（第2方向あるいは厚み方向）とし、紙厚方向を「上下方向」（第3方向あるいは吐出方向）とし、具体的には、図2に記載の方向矢印に準拠する。図2以外の図面についても、図2の方向を

基準とする。

[0022] なお、図 7 A および図 7 B において、マニホールド 2 1（後述）、シム 1 3（後述）およびアタッチメント部材 2 5（後述）の相対配置を明確に示すために、第 2 ブロック 1 2（後述）を省略している。さらに、図 8 において、シム 1 3、第 1 ブロック 1 1 および第 2 ブロック 1 2 の相対配置を明確に示すために、アタッチメント部材 2 5 を省略している。また、図 7 B において、第 2 シム 1 5（後述）の形状を明確に示すために、第 1 シム 1 4（後述）を省略している。

[0023] 図 1 において、この塗布装置 1 は、粒子および樹脂を含むワニス（後で詳述する）を塗布するための塗布装置である。塗布装置 1 は、タンク 2 と、ポンプ 3 と、ノズル 5 とを備える。タンク 2、ポンプ 3 およびノズル 5 は、ワニスの吐出方向上流側から下流側に向かって、順次配置されている。

[0024] タンク 2 は、ワニスを貯蔵するリザーバであって、塗布装置 1 の上側部分に設けられている。

[0025] ポンプ 3 は、タンク 2 と第 1 配管 6 1 を介して接続されており、具体的には、タンク 2 の前側に配置されている。ポンプ 3 は、タンク 2 内に貯蔵されるワニスをノズル 5 に所定の圧力を負荷して吐出できるポンプであれば特に限定されず、例えば、モノポンプ（具体的には、ヘイシンモノポンプ（兵神装備社製）として市販されるポンプなど）などが挙げられる。

[0026] 図 1 に示すように、ノズル 5 は、例えば、スロットダイコータであって、具体的には、ポンプ 3 の下側に配置されており、ポンプ 3 に第 2 配管 6 9 を介して接続されている。ノズル 5 は、上下方向および左右方向に延びる厚肉平板形状に形成されている。ノズル 5 は、第 1 ブロック 1 1 と、第 1 ブロック 1 1 の前側に対向配置される第 2 ブロック 1 2 と、第 1 ブロック 1 1 および第 2 ブロック 1 2 の間に介在するシム 1 3 とを備える。

[0027] 第 1 ブロック 1 1 は、例えば、ステンレスなどの金属、あるいは、アクリル樹脂などの樹脂から形成されている。第 1 ブロック 1 1 は、好ましくは、耐久性の観点から、金属から形成されている。

[0028] 図2および図8に示すように、第1ブロック11は、上下方向および左右方向に延びる厚肉平板形状をなし、具体的には、平面視および正面視において、略矩形状に形成され、側面視において、上側部分が略矩形状に形成され、下側部分が、下側に向かうに従って前後方向長さが短くなる略三角形状に形成されている。また、第1ブロック11は、前面の中央部が後側に凹む有底枠形状に形成されている。第1ブロック11は、上壁46aと、下壁46bと、1対の側壁46cとを一体的に備える。

[0029] 上壁46aは、左右方向に延びる平面視略矩形状、かつ、正面視略矩形状に形成されている。また、上壁46aは、図5および図6に示すように、側面視において、上側部分が略矩形状をなし、下側部分の下面47が湾曲面となるように形成されている。具体的には、上壁46aの下面47は、後方に向かうに従って次第に下側に湾曲する円弧形状に形成されている。

[0030] 下壁46bは、上壁46aの下端部に隣接して設けられている。下壁46bは、図3および図7A-7Bに示すように、左右方向に延びる底面視略矩形状、かつ、正面視略矩形状に形成されている。また、下壁46bは、図5および図6に示すように、側面視において、その下面が前側に向かうに従って下方に直線状に傾斜する傾斜面として形成されるとともに、その上面48が前側に向かうに従って下方に直線状に傾斜する傾斜面として形成される。下壁46bの上面48の上端縁は、上壁46aの下面47の下端縁に連続するように形成されている。

[0031] 1対の側壁46cは、図7A-7Bおよび図8に示すように、上壁46aおよび下壁46bの左右方向両端部に連続しており、上下方向に延びる平面視略矩形状に形成されている。また、側壁46cは、側面視において、上側部分が略矩形状をなし、下側部分が、下側に向かうに従って前後方向長さが短くなる略三角形状に形成されている。

[0032] そして、第1ブロック11では、上壁46a、下壁46bおよび1対の側壁46cの前面が、面一の正面視略矩形状に形成されている。また、図5および図7A-7Bに示すように、第1ブロック11では、上壁46aの下

面47と、下壁46bの上面48と、1対の側壁46cの内面（内側面）とから、マニホールド21が形成される。マニホールド21は、後述する供給孔20から供給されるワニスを左右方向に広げるために設けられる。

[0033] 具体的には、マニホールド21は、流入部50および流出部51を備える。

[0034] 流入部50は、上壁46aの下面47と、1対の側壁46cの内面（内側面）とによって形成される。流入部50は、左右方向および前後方向（吐出方向に対する直交方向）に沿う開口断面積が、下方（吐出方向下流側）に向かうに従って拡大するように、形成されている。この流入部50によって、流入空間52が仕切られる。

[0035] 流出部51は、下壁46bの上面48と、1対の側壁46cの内面（内側面）とによって形成される。流出部51は、左右方向および前後方向（吐出方向に対する直交方向）に沿う開口断面積が、吐出方向に向かうに従って縮小するように、形成されている。この流出部51によって、流出空間53が、流入空間52に連通するように、仕切られる。

[0036] このマニホールド21によって、マニホールド空間が仕切られる。

[0037] マニホールド空間は、流入空間52と、流出空間53とから形成される。

[0038] また、上壁46aには、上壁46aを上下方向に貫通する供給孔20が形成されている。供給孔20は、ポンプ3から第2配管69を介してワニスをキャビティ49（後述する）に供給するために上壁46aに形成されており、略円柱形状にされている。また、図2に示すように、供給孔20は、平面視において、上壁46aの左右方向略中央部に設けられている。なお、図5に示すように、供給孔20の下端部は、下側斜め前方に屈曲して、上壁46aの下面47に開口されている。

[0039] また、図7A－7Bに示すように、上壁46aおよび1対の側壁46cには、それらの前面から後方に向かって穿孔される第1固定孔28が形成される。第1固定孔28は、互いに間隔を隔てて複数設けられている。具体的には、第1固定孔28は、上壁46aの前面において、左右方向に等間隔を隔

てて形成されている。また、第1固定孔28は、1対の側壁46cの前面において、上下方向に等間隔を隔てて形成されている。

[0040] さらに、図4および図7A-7Bに示すように、1対の側壁46cには、左右方向を貫通する第2固定孔29が形成されている。第2固定孔29は、1対の側壁46cにおいて、流入空間52（図5参照）に連通する位置に設けられている。

[0041] そして、図6および図7A-7Bに示すように、マニホールド21には、アタッチメント部材25が装着されている。

[0042] アタッチメント部材25は、マニホールド21の上側（吐出方向上流側）部分において、左右方向に互いに間隔を隔てて2つ設けられている。

[0043] 各アタッチメント部材25は、図2の破線および図6に示すように、左右方向に延びる平面視略矩形状をなし、その左右方向外側面が、上下方向に延びる平坦状に形成されている。また、アタッチメント部材25は、側面視扇状をなし、その下面が平坦面に形成されており、上面が、後方に向かうに従って次第に下側に湾曲する円弧形状に形成されている。アタッチメント部材25は、図7A-7Bの太線および細線のハッチングで示されるように、正面視略三角形状（具体的には、直角三角形状）に形成されている。また、2つのアタッチメント部材25の下面は、正面視において、左右方向外側に向かうに従って下側に傾斜する傾斜面として形成されており、それらは、左右方向に互に対向するように配置されている。

[0044] また、図6に示すように、アタッチメント部材25には、上下方向および左右方向に投影したときに、第1ブロック11から前側にわずかに突出する突出部分が形成されている。

[0045] 図6および図7A-7Bに示すように、アタッチメント部材25の下面の左右方向両外端縁は、前後方向に投影したときに、上壁46aの下面47の下端縁に重なるように配置されている。また、アタッチメント部材25の下面の左右方向内端縁は、供給孔20の左右方向両端部に隣接して、供給孔20を露出するように、供給孔20の下端部の左右方向両外側に隣接配置され

ている。

[0046] このアタッチメント部材 25 がマニホールド 21 に装着されることによって、キャビティ 49 の流入空間 52 に、左右方向長さが、下側に向かうに従って、次第に長くなる拡大部 33 が形成される。

[0047] 拡大部 33 は、供給孔 20 を中心として、その左右方向長さが、下方に向かうに従って、次第に長くなるように、略逆 V 字形状に形成されている。

[0048] 第 2 ブロック 12 は、例えば、ガラス、アクリル樹脂（具体的には、ポリメタクリル酸メチル）、シリコン樹脂などの透明樹脂などの透明材料から形成される透明部材である。

[0049] 第 2 ブロック 12 は、図 8 に示すように、左右方向に延びる平板形状をなし、下端部が、下側に向かうに従って前後方向長さが短くなる略三角形形状に形成されている。また、第 2 ブロック 12 は、前後方向に投影したときに、第 1 ブロック 11 と重複するように形成されている。第 2 ブロック 12 の上面および両側面は、第 1 ブロック 11 における上面および両側面と面一に形成され、また、第 2 ブロック 12 の下端部は、第 1 ブロック 11 における下端部と、前後方向に投影したときに、同一位置に配置されている。

[0050] なお、図示しないが、第 2 ブロック 12 には、正面視において、第 1 ブロック 11 と同じ配置および大きさの複数の第 1 固定孔 28（図 7 A - 7 B 参照）が形成されている。

[0051] シム 13 は、例えば、第 1 ブロック 11 と同様の材料から形成されている。シム 13 は、第 1 シム 14 と、第 1 シム 14 の前側に配置される第 2 シム 15 とを備える。

[0052] 第 1 シム 14 は、下側が開放される正面視略逆 U 字形状に形成される薄板である。第 1 シム 14 は、前後方向に投影したときに、第 1 ブロック 11 の上壁 46 a の前面および 1 対の側壁 46 c の前面と重複するように配置されている。

[0053] 第 2 シム 15 は、図 7 B（細線で示すハッチング参照）および図 8 に示すように、下側が開放される正面視略逆 U 字形状に形成される薄板である。ま

た、第2シム15は、正面視において、第1シム14より内側に膨出するように形成されている。具体的には、第2シム15は、前後方向に投影したときに、第1シム14と重複する重複部17と、第1シム14から左右方向内側に露出し、かつ、重複部分17から内側に膨出する膨出部16とを一体的に備える。

[0054] 膨出部16は、第2シム15における1対の側壁46cと対向する側壁対向部17cから左右方向内側に略矩形状に膨出するように形成されている。図7Bに示すように、膨出部16は、前後方向に投影したときに、アタッチメント部材25に重複しないように、上端部分が正面視略矩形状に切り欠かれている。詳しくは、膨出部16は、上端部の内端縁から左右方向両外側に向かって切り欠かれている。

[0055] また、第1シム14および第2シム15のそれぞれには、正面視において、第1ブロック11と同じ配置および大きさの複数の第1固定孔28（図7参照）が形成されている。

[0056] 次に、ノズル5の組み付けについて、図8および図9を参照して説明する。

[0057] まず、第1ブロック11、アタッチメント部材25、第1シム14、第2シム15および第2ブロック12のそれぞれを用意する。

[0058] 次いで、第1ブロック11のマニホールド21に、アタッチメント部材25を装着するとともに、上壁46aの前面および下壁46bの前面（図7A－7B参照）にシム13（第1シム14および第2シム15）を配置する。

[0059] 具体的には、アタッチメント部材25を、マニホールド21に嵌め込んだ後、図示しない固定部材を第2固定孔29（図4および図7A－7B参照）に挿通し、アタッチメント部材25に到達させ、これによって、アタッチメント部材25をマニホールド21に固定する。

[0060] また、第1シム14を、上壁46aの前面および下壁46bの前面に接触させる。

[0061] 続いて、第2シム15の重複部分17を第1シム14の前面に接触させる

。この際、膨出部 16 が、第 1 シム 14 から左右方向内側に露出するように、第 2 シム 15 を第 1 シム 14 に配置する。また、第 2 シム 15 の膨出部 16 の切欠部分に、アタッチメント部材 25 を通過させる。

[0062] 次いで、第 2 ブロック 12 の後面を、第 2 シム 15 の前面と、アタッチメント部材 25 の前面とに接触させる。続いて、図示しない固定部材を、第 1 ブロック 11、シム 13 および第 2 ブロック 12 の第 1 固定孔 28（図 7 A－7 B 参照）に挿通し、固定する。これによって、第 1 ブロック 11 および第 2 ブロック 12 によって、シム 13（第 1 シム 14 および第 2 シム 15）を挟み込み、ノズル 5 を組み付ける。

[0063] これによって、図 5 に示すように、ノズル 5 には、第 1 ブロック 11 のマニホールド 21 と、シム 13 の内側面と、第 2 ブロック 12 の後面とによって仕切られるキャビティ 49 とが形成される。

[0064] これとともに、第 1 ブロック 11 の下壁 46 b の前面と、シム 13 の内側面（図 7 A－7 B および図 8 参照）と、第 2 ブロック 12 の後面とによって仕切られるスリット 56 が形成される。スリット 56 は、左右方向に延びる平面視略矩形状に開口され、また、上下方向に延びる側面視略矩形状に開口されている。

[0065] また、図 3 および図 5 に示すように、スリット 56 の下端部（吐出口）は、スロット 57 が開口される。スロット 57 は、底面視において、左右方向に細長く延びる吐出口として形成される。

[0066] また、図 3 に示すように、スロット 57 は、その左右方向端部の前端部に膨出部 16 が膨出した吐出口として形成される。詳しくは、膨出部 16 は、第 1 シム 14 から膨出する分、スロット 57 の左右方向端部の開口断面積を、左右方向途中（中央部）の開口断面積に対して、減少させている。具体的には、スロット 57 の左右方向両端部では、膨出部 16 が設けられる分、その前後方向長さは、左右方向途中（中央部）の前後方向長さに比べて、約 2 分の 1 である。

[0067] そのため、スロット 57 は、左右方向両端部におけるワニス吐出流れは、

膨出部 16 によって抑制される。

[0068] そのため、スロット 57 の左右方向両端部では、開口断面積が減少する分、開口断面積が維持されたスロット 57 の左右方向中央（途中）部に比べて、吐出流れが、低下する。

[0069] スリット 56 を仕切る下壁 46 b、シム 13 および第 2 ブロック 12 は、吐出部 23 とされる。

[0070] ノズル 5 の寸法は、ワニスの物性（粘度を含む）、塗膜 60（図 10 参照）の形状および／または厚さによって適宜設定され、特に限定されない。ノズル 5 の幅（左右方向長さ）は、例えば、30 mm 以上、好ましくは、50 mm 以上であり、また、例えば、500 mm 以下、好ましくは、200 mm 以下である。また、供給孔 20 の内径は、例えば、2 mm 以上、好ましくは、5 mm 以上であり、また、例えば、30 mm 以下、好ましくは、15 mm 以下である。また、キャビティ 49、スリット 56 およびスロット 57 の幅（左右方向長さ）は、例えば、10 mm 以上、好ましくは、30 mm 以上であり、また、例えば、450 mm 以下、好ましくは、150 mm 以下である。また、流入空間 52 の上下方向長さは、例えば、3 mm 以上、好ましくは、5 mm 以上であり、また、例えば、80 mm 以下、好ましくは、50 mm 以下であり、前後方向長さは、例えば、3 mm 以上、好ましくは、5 mm 以上であり、また、例えば、50 mm 以下、好ましくは、30 mm 以下である。流出空間 53 の上下方向長さは、例えば、3 mm 以上、好ましくは、5 mm 以上であり、また、例えば、80 mm 以下、好ましくは、50 mm 以下である。

[0071] また、アタッチメント部材 25 の幅（左右方向長さ）は、例えば、5 mm 以上、好ましくは、15 mm 以上であり、また、例えば、200 mm 以下、好ましくは、70 mm 以下である。また、アタッチメント部材 25 の上下方向長さは、例えば、3 mm 以上、好ましくは、5 mm 以上であり、また、例えば、80 mm 以下、好ましくは、50 mm 以下である。また、アタッチメント部材 25 の前後方向長さは、例えば、3 mm 以上、好ましくは、5 mm

以上であり、また、例えば、50 mm以下、好ましくは、30 mm以下である。

[0072] スリット56の前後方向長さおよびスロット57（吐出口）の前後方向長さは、シム13の前後方向の長さを実質的に同一であり、例えば、0.1 mm以上、好ましくは、0.5 mm以上であり、また、例えば、3 mm以下、好ましくは、2 mm以下である。

[0073] また、第1シム14の厚みは、例えば、0.05 mm以上、好ましくは、0.2 mm以上であり、また、例えば、3 mm以下、好ましくは、1.5 mm以下である。また、第2シム15の厚みは、例えば、第1シム14と同一であり、具体的には、例えば、0.05 mm以上、好ましくは、0.2 mm以上であり、また、例えば、3 mm以下、好ましくは、1.5 mm以下である。

[0074] また、膨出部16の膨出長さ（左右方向長さ）は、例えば、0.2 mm以上、好ましくは、1 mm以上であり、また、例えば、6 mm以下、好ましくは、3 mm以下である。

[0075] なお、この塗布装置1には、図1に示すように、ノズル5を前後方向、左右方向および／または上下方向に移動可能な移動装置55が、ポンプ3の上側に隣接して設けられている。

[0076] 次いで、この塗布装置1を用いてワニスを塗布する方法について、図1および図10を参照して説明する。

[0077] この方法では、まず、ワニスを調製する。

[0078] ワニスは、粒子および樹脂を必須成分として含有する。

[0079] 粒子としては、塗膜の用途および目的に応じて適宜設定され、例えば、蛍光体、充填剤が挙げられる。

[0080] 蛍光体は、波長変換機能を有しており、例えば、青色光を黄色光に変換することのできる黄色蛍光体、青色光を赤色光に変換することのできる赤色蛍光体などが挙げられる。

[0081] 黄色蛍光体としては、例えば、 $(Ba, Sr, Ca)_2SiO_4; Eu$ 、（

$\text{Sr, Ba}_2\text{SiO}_4:\text{Eu}$ (バリウムオルソシリケート (BOS)) などのシリケート蛍光体、例えば、 $\text{Y}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}:\text{Ce}$ (YAG (イットリウム・アルミニウム・ガーネット) : Ce)、 $\text{Tb}_3\text{Al}_3\text{O}_{12}:\text{Ce}$ (TAG (テルビウム・アルミニウム・ガーネット) : Ce) などのガーネット型結晶構造を有するガーネット型蛍光体、例えば、 $\text{Ca}-\alpha-\text{SiAlON}$ などの窒化物蛍光体などが挙げられる。

[0082] 赤色蛍光体としては、例えば、 $\text{CaAlSiN}_3:\text{Eu}$ 、 $\text{CaSiN}_2:\text{Eu}$ などの窒化物蛍光体などが挙げられる。

[0083] 蛍光体の形状としては、例えば、球状、板状、針状などが挙げられる。好ましくは、流動性の観点から、球状が挙げられる。

[0084] 蛍光体の最大長さの平均値 (球状である場合には、平均粒子径) は、例えば、 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以上、好ましくは、 $1\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、また、例えば、 $200\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは、 $100\text{ }\mu\text{m}$ 以下でもある。

[0085] 蛍光体の比重は、例えば、例えば、 2.0 以上であり、また、例えば、 9.0 以下である。

[0086] 蛍光体は、単独使用または併用することができる。

[0087] 蛍光体の配合割合は、樹脂 100 質量部に対して、例えば、 0.1 質量部以上、好ましくは、 0.5 質量部以上であり、例えば、 80 質量部以下、好ましくは、 60 質量部以下でもある。

[0088] 充填剤は、塗膜の靱性を向上させるためにワニスに配合され、例えば、シリコーン粒子などの有機微粒子、例えば、シリカ、タルク、アルミナ、窒化アルミニウム、窒化ケイ素などの無機微粒子が挙げられる。

[0089] 充填剤の比重は、例えば、 0.5 以上であり、また、例えば、 7.0 以下である。

[0090] 充填剤の最大長さの平均値 (球状である場合には、平均粒子径) は、例えば、 $0.1\text{ }\mu\text{m}$ 以上、好ましくは、 $0.5\text{ }\mu\text{m}$ 以上であり、また、例えば、 $200\text{ }\mu\text{m}$ 以下、好ましくは、 $100\text{ }\mu\text{m}$ 以下でもある。

[0091] 充填剤は、単独使用または併用することができる。

[0092] 充填剤の配合割合は、樹脂100質量部に対して、例えば、0.1質量部以上、好ましくは、0.5質量部以上であり、また、例えば、70質量部以下、好ましくは、50質量部以下でもある。

[0093] 蛍光体と充填剤とを併用する場合の配合割合は、樹脂100質量部に対して、蛍光体と充填剤との合計量が、例えば、0.1質量部以上、好ましくは、0.5質量部以上であり、例えば、80質量部以下、好ましくは、60質量部以下である。

[0094] 樹脂としては、例えば、シリコン樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、不飽和ポリエステル樹脂などの硬化性樹脂が挙げられる。

[0095] また、樹脂として、例えば、ポリオレフィン（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、エチレン-プロピレン共重合体など）、アクリル樹脂（例えば、ポリメタクリル酸メチルなど）、ポリ酢酸ビニル、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリ塩化ビニル、ポリスチレン、ポリアクリロニトリル、ポリアミド、ポリカーボネート、ポリアセタール、ポリエチレンテレフタレート、ポリフェニレンオキシド、ポリフェニレンスルフィド、ポリスルホン、ポリエーテルスルホン、ポリエーテルエーテルケトン、ポリアリルスルホン、熱可塑性ポリイミド、熱可塑性ウレタン樹脂、ポリアミノビスマレイミド、ポリアミドイミド、ポリエーテルイミド、ビスマレイミドトリアジン樹脂、ポリメチルペンテン、フッ化樹脂、液晶ポリマー、オレフィン-ビニルアルコール共重合体、アイオノマー、ポリアリレート、アクリロニトリル-エチレン-スチレン共重合体、アクリロニトリル-ブタジエーン-スチレン共重合体、アクリロニトリル-スチレン共重合体などの熱可塑性樹脂も挙げられる。

[0096] 樹脂として、好ましくは、硬化性樹脂、より好ましくは、硬化性シリコン樹脂が挙げられる。

[0097] 硬化性シリコン樹脂としては、例えば、2段階硬化型シリコン樹脂、1段階硬化型シリコン樹脂などが挙げられる。

- [0098] 2段階硬化型シリコン樹脂は、2段階の反応機構を有しており、1段階目の反応でBステージ化（半硬化）し、2段階目の反応でCステージ化（完全硬化）する硬化性シリコン樹脂である。
- [0099] また、Bステージは、2段階硬化型シリコン樹脂が、溶剤に可溶なAステージと、完全硬化したCステージとの間の状態であって、硬化およびゲル化がわずかに進行し、溶剤に膨潤するが完全に溶解せず、加熱によって軟化するが溶融しない状態である。
- [0100] 1段階硬化型シリコン樹脂は、1段階の反応機構を有しており、1段階目の反応で完全硬化する硬化性シリコン樹脂である。
- [0101] また、硬化性シリコン樹脂として、例えば、加熱により硬化する熱硬化性シリコン樹脂、例えば、活性エネルギー線（例えば、紫外線、電子線など）の照射により硬化する活性エネルギー線硬化性シリコン樹脂などが挙げられる。好ましくは、熱硬化性シリコン樹脂が挙げられる。
- [0102] 樹脂の比重は、例えば、蛍光体および／または充填剤の比重より軽く、具体的には、例えば、0.5以上であり、また、例えば、2.0以下である。
- [0103] 樹脂の配合割合は、ワニスに対して、例えば、0.1質量%以上、好ましくは、0.5質量%以上であり、また、例えば、100質量%未満、好ましくは、99.5質量%以下である。
- [0104] また、ワニスには、必要により、溶媒や添加剤などの任意成分を適宜の割合で配合することができる。溶媒としては、例えば、ヘキサンなどの脂肪族炭化水素、例えば、キシレンなどの芳香族炭化水素、例えば、ビニルメチル環状シロキサン、両末端ビニルポリジメチルシロキサンなどのシロキサンなどが挙げられる。
- [0105] 添加剤としては、例えば、分散剤、シランカップリング剤、レベリング剤などの表面調整剤などが挙げられる。
- [0106] 上記した各成分を配合して、攪拌混合することによって、ワニスを調製する。
- [0107] ワニスの25℃、1気圧の条件下における粘度は、例えば、1,000 m

$\text{Pa} \cdot \text{s}$ 以上、好ましくは、 $4,000 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以上であり、また、例えば、 $1,000,000 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以下、好ましくは、 $100,000 \text{ Pa} \cdot \text{s}$ 以下である。なお、粘度は、ワニスを 25°C に温度調節し、E型コーンを用いて、回転数 99 s^{-1} で測定される。

[0108] 次いで、調製したワニスをタンク2に投入する。

[0109] 別途、基材54を用意する。

[0110] 基材54は、シート状に形成されており、その外形形状は特に限定されず、例えば、図1に示すように、平面視略矩形状（短冊状、長尺状を含む）などに形成されている。また、基材54は、水平方向に沿って配置される。

[0111] 基材54は、例えば、ポリエチレンテレフタレート（PET）などのポリエステル樹脂、例えば、ポリプロピレンなどのポリオレフィン樹脂などの樹脂からシート状に形成されている。また、基材54を、例えば、金属から形成することもできる。基材54の表面には、剥離処理などを施すこともできる。

[0112] 次いで、図10が参照されるように、ノズル5の吐出部23（スロット57）を、基材54に対向させて、吐出部23を基材54に近接させる。

[0113] この際、ドクター26と基材54との上下方向長さを、例えば、塗膜60（図10参照）の所望の厚み以上、あるいは、例えば、同じ厚みに設定し、具体的には、例えば、 $10 \mu\text{m}$ 以上、好ましくは、 $30 \mu\text{m}$ 以上であり、また、例えば、 $3000 \mu\text{m}$ 以下、好ましくは、 $2800 \mu\text{m}$ 以下に設定する。

[0114] 続いて、ポンプ3を駆動させるとともに、移動装置55によって、ノズル5を前方に水平移動させる。

[0115] すると、ポンプ3の駆動により、ワニスは、タンク2から、第1配管61、ポンプ3および第2配管69を介して供給孔20（図5参照）に案内される。

[0116] すると、ワニスは、流入空間52に流入し、拡大部33において、図7A-7Bが参照されるように、左右方向に次第に広げられるとともに、ポンプ

3の駆動および／または重力によって、流出空間53に流出される。続いて、流出空間53において、図6に示すように、ワニスは、前後方向に狭められながら、下方に流れ、スリット56に至る。

[0117] その後、スリット56では、膨出部16によって、左右方向両端部（第1方向両端部）の流れが抑制されながら、吐出部23においても、膨出部16によって、左右方向両端部の吐出が抑制されながら、スロット57から基材54に向けて吐出される。

[0118] 基材54に吐出されたワニスは、前方に移動するノズル5の第1ブロック11のドクター26によって厚みが整えられる。

[0119] その後、必要により、ワニスを乾燥させて、塗膜60を形成する。

[0120] なお、ワニスを基材54に対して断続的に塗布することによって、塗膜60を枚葉式で形成することができ、あるいは、ワニスを基材54に対して連続的に吐出することによって、塗膜60を連続式で形成することもできる。なお、その後、連続式の塗膜60を、切断などの外形加工によって、枚葉式とすることもできる。

[0121] その後、必要により、樹脂が硬化性樹脂を含む場合には、熱や活性エネルギー線などによって、硬化処理を施す。これによって、硬化後（あるいは半硬化後）の塗膜60を形成する。

[0122] なお、樹脂が熱可塑性樹脂を含む場合には、塗布装置1にヒータを設けて、上記した処理を加熱して、樹脂を溶融あるいは軟化させながら、実施する。

[0123] そして、この塗布装置1では、膨出部16によって、吐出部23の左右方向両端部におけるワニスの吐出を相対的に抑制することができる。つまり、吐出部23の左右方向両端部におけるワニスの吐出を、吐出部23の左右方向途中部におけるワニスの吐出に対して、抑制することができる。そのため、塗膜60の左右方向両端部における厚み方向の盛り上がりを抑制して、塗膜60の平坦性を確保することができる。

[0124] 一方、この塗布装置1では、吐出部23の左右方向両端部において、たと

え、ワニスの吐出流れが低下したとしても、マニホールド 21 を通過するワニスは、拡大部 33 において、下側（吐出方向下流側）に向かうに従って、左右方向両側（第 1 方向外側）に次第に広げられるので、ワニスが粒子を含むことに起因するワニスの吐出流れが緩慢になることを防止し、ワニスの滞留が生じることを防止することができる。その結果、マニホールド 21 においてワニスにおける粒子の不均一性を解消することができる。従って、得られる塗膜 60 の平坦性を確保しながら、塗膜 60 における粒子の均一性を十分に確保することができる。

[0125] また、流入空間 52 は、供給孔 20 に比べて、吐出方向と直交する方向に沿う開口断面積が大きくなり、しかも、流入空間 52 において、開口断面積が、下方に向かうに従って拡大するので、ワニスを、左右方向に迅速に広げることができる。一方、流出空間 53 は、開口断面積が、下方に向かうに従って縮小するので、ワニスに圧力を負荷しながらスリット 56 に送り込むことができる。

[0126] しかし、マニホールド 21 において、流入部 50 では、流出部 51 に比べて、上記したワニスの吐出流れが緩慢になり易く、それに起因するワニスの滞留を生じ易い。

[0127] しかし、この塗布装置 1 では、拡大部 33 が流入部 50 に設けられているので、上記したワニスの吐出流れが緩慢になることを防止して、ワニスの滞留が生じることを防止することができる。

[0128] 図 7A - 7B の説明では、アタッチメント部材 25 をマニホールド 21 に対して着脱可能に構成しているが、例えば、図示しないが、アタッチメント部材 25 をマニホールド 21 と一体的に構成することもできる。好ましくは、アタッチメント部材 25 をマニホールド 21 に対して着脱可能に構成する。このような塗布装置 1 によれば、ワニスの特性に応じて、所望形状のアタッチメント部材 25 に交換することができる。具体的には、ワニスの粘度に応じて、アタッチメント部材 25 の下面（傾斜面）の傾斜角を変更する。詳しくは、粒子の種類、配合割合、形状、平均粒子径や、樹脂の種類、配合割

合、粘度など、つまり、ワニスの処方に応じて、上記したアタッチメント部材 25 の（傾斜面）の傾斜角を変更して、上記したワニスの滞留を簡単に防止することができる。

[0129] また、第 2 ブロック 12 を、透明部材としているが、例えば、金属からなる不透明部材とすることもできる。好ましくは、第 2 ブロック 12 を透明部材とする。このような塗布装置 1 によれば、透明部材である第 2 ブロック 12 を介して、拡大部 33 を含むキャビティ 49 を通過するワニスを目視することができるので、ワニスにおける粒子の状態を簡単に検査することができる。

[0130] なお、拡大部 33 においてワニスの滞留を確認するために、上記した透明材料からなる第 2 ブロック 12 に限定されず、例えば、第 2 ブロック 12 において、拡大部 33 に対向する部分（例えば、窓部）を、透明材料から形成し、それ以外の部分を、不透明部材とすることもできる。

[0131] なお、図 1 の実施形態では、基材 54 に対して、ノズル 5 を移動させているが、例えば、基材 54 とノズル 5 とが相対移動すればよく、図示しないが、ノズル 5 に対して基材 54 を移動させることもできる。

[0132] 上記した説明では、スロット 57 を下方に向けるように、ノズル 5 を設けているが、例えば、側方または上方に向けることもできる。

[0133] また、図 3 の実施形態では、膨出部 16 を第 2 シム 15 に設けているが、例えば、図 11 に示すように、第 1 シム 14 に設けることもできる。

[0134] さらに、図 3 の実施形態では、2つの膨出部 16 をともに第 2 シム 15 に設けているが、例えば、図 12 に示すように、一方の膨出部 16 を、右側部分の第 2 シム 15 に設けて、かつ、他方の膨出部 16 を、左側部分の第 1 シム 14 に設けることもできる。

[0135] また、図 3 の実施形態では、膨出部 16 を底面視略矩形状に形成しているが、例えば、図 13 に示すように、後側に向かって左右方向長さが短くなる底面視略三角形状に形成することもできる。

[0136] また、図 7 B の実施形態では、膨出部 16 を、キャビティ 49 およびスリ

ット56に対応する部分にわたって、形成しているが、例えば、図15に示すように、スリット56に対応する部分のみに形成することもできる。

[0137] また、図1の実施形態では、ノズル5を前方に移動させているが、移動方向はこれに限定されず、例えば、ノズル5を後方に移動させることもできる。この場合には、図10が参照されるように、第2ブロック12のドクター26によって塗膜60の厚みを調整する。

[0138] また、上記各実施形態において、ノズル5における各部品に、面取り加工などの加工処理を施すこともできる。

実施例

[0139] 以下に示す実施例および比較例における数値は、上記の実施形態において記載される対応する数値（すなわち、上限値または下限値）に代替することができる。

[0140] 実施例1

<ワニスの調製>

液状シリコーン樹脂（LR7665のA液、1段階硬化型シリコーン樹脂、比重1.0、信越化学工業社製）80質量部に、シリコーン粒子（トスパール2000B、比重1.32、モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン社製）20質量部を添加し、さらに、YAG:Ce（Y-468、比重4.5、黄色蛍光体、ネモト・ルミマテリアル社製）15質量部を添加して、これらを攪拌混合して、ワニスを調製した。

[0141] ワニスの25℃、1気圧の条件下における粘度は、40,000mPa・sであった。

[0142] <基材への塗布>

図1～図10に示すように、タンク、ポンプ、ノズル（アタッチメント部材および膨出部を含む）および移動装置を備える塗布装置を用意した。ノズルの寸法を以下に示す。

[0143] [ノズル]

ノズルの幅（左右方向長さ）

70mm

供給孔の内径	10.5 mm
キャビティの幅（左右方向の最大長さ）	54 mm
流入空間の上下方向長さ	10 mm
流入空間の前後方向長さ	10 mm
流出空間の上下方向長さ	10 mm
アタッチメント部材の幅	22 mm
アタッチメント部材の上下方向長さ	10 mm
アタッチメント部材の前後方向長さ	10 mm
スロットの幅（左右方向の最大長さ）	50 mm
スリットの前後方向長さ	1 mm
スリットの上下方向長さ	10 mm
スロットの前後方向長さ	1 mm
第1シムの厚み（前後方向長さ）	0.4 mm
第2シムの厚み（前後方向長さ）	0.6 mm
膨出部の膨出長さ（左右方向長さ）	3 mm

次いで、調製したワニスをタンクに投入し、別途、PETからなる基材を用意した。

[0144] 次いで、移動装置によって、ドクターと基材との上下方向長さが400 μ mとなるように、ノズルのスロットを基材に対向させた。

[0145] 続いて、ポンプを駆動させるとともに、移動装置によって、ノズルを前方に140 mmだけ水平移動させた。

[0146] これによって、左右方向長さ54 mm、前後方向長さが140 mm、厚み0.4 mmの塗膜を製造した。

[0147] 比較例1

ノズルにアタッチメント部材を装着しなかった以外は、実施例1と同様に処理して、塗膜を製造した。

[0148] <評価>

実施例1および比較例1における塗布時のノズルにおけるワニスを第2ブ

ロック側から目視にて観察した。その写真を図15および図16に示す。

[0149] ノズルにアタッチメント部材を装着しない比較例1では、上側空間の上端部および左右方向両端部の隅部に、YAG:Ce（黄色蛍光体）が希薄となる希薄部分が確認でき、隅部において、ワニスの滞留が確認できた。

[0150] 比較例1に対して、実施例1では、ワニスにおいてYAG:Ce（黄色蛍光体）の希薄部分が確認されず、YAG:Ce（黄色蛍光体）が均一であることが分かった。

[0151] なお、上記発明は、本発明の例示の実施形態として提供したが、これは単なる例示に過ぎず、限定的に解釈してはならない。当該技術分野の当業者によって明らかな本発明の変形例は、後記特許請求の範囲に含まれる。

産業上の利用可能性

[0152] 塗布装置は、塗膜の製造に用いられる。

符号の説明

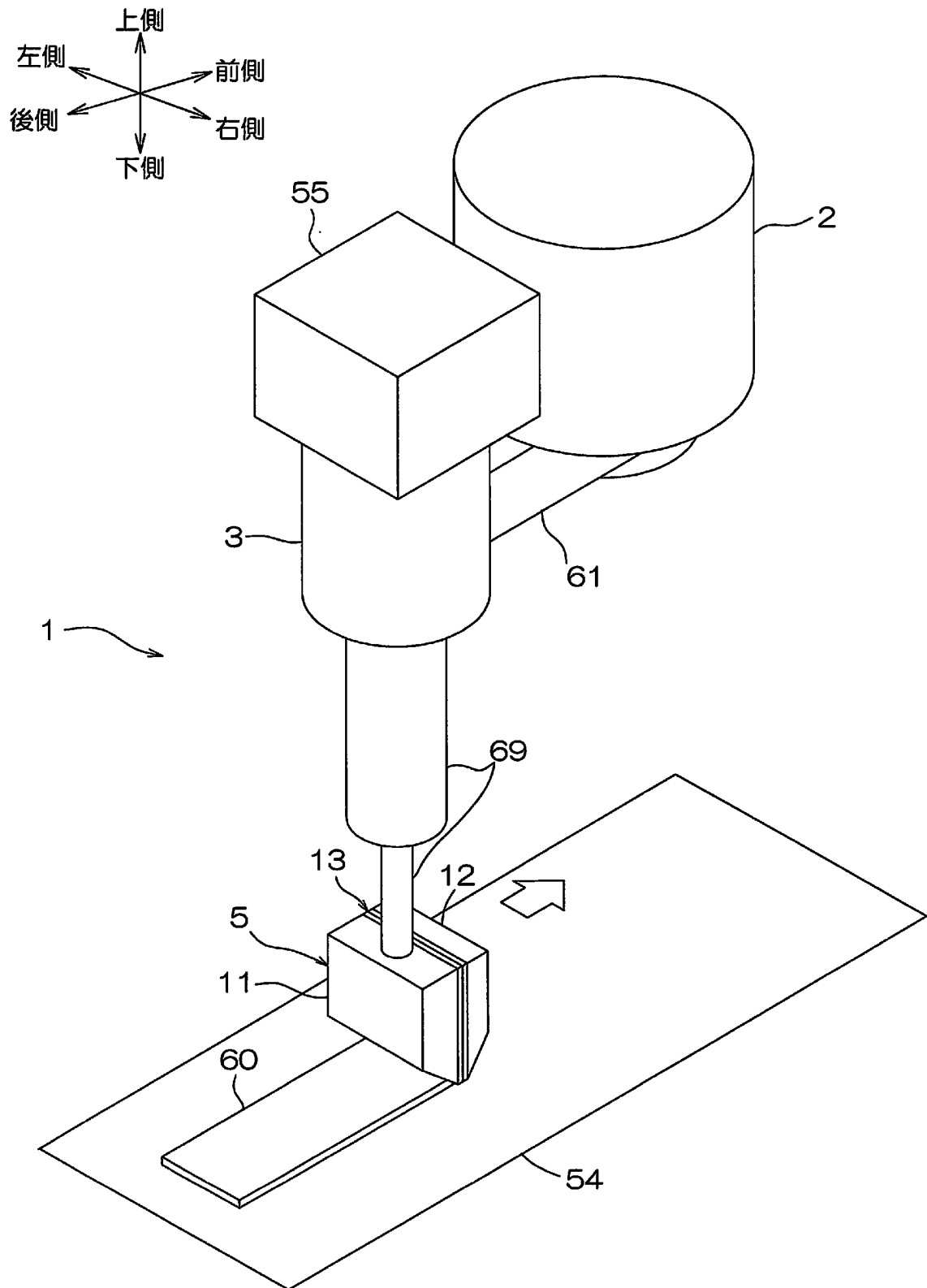
- [0153] 1 塗布装置
5 ノズル
12 第2ブロック（透明部材）
16 膨出部
21 マニホールド
23 吐出部
33 拡大部

請求の範囲

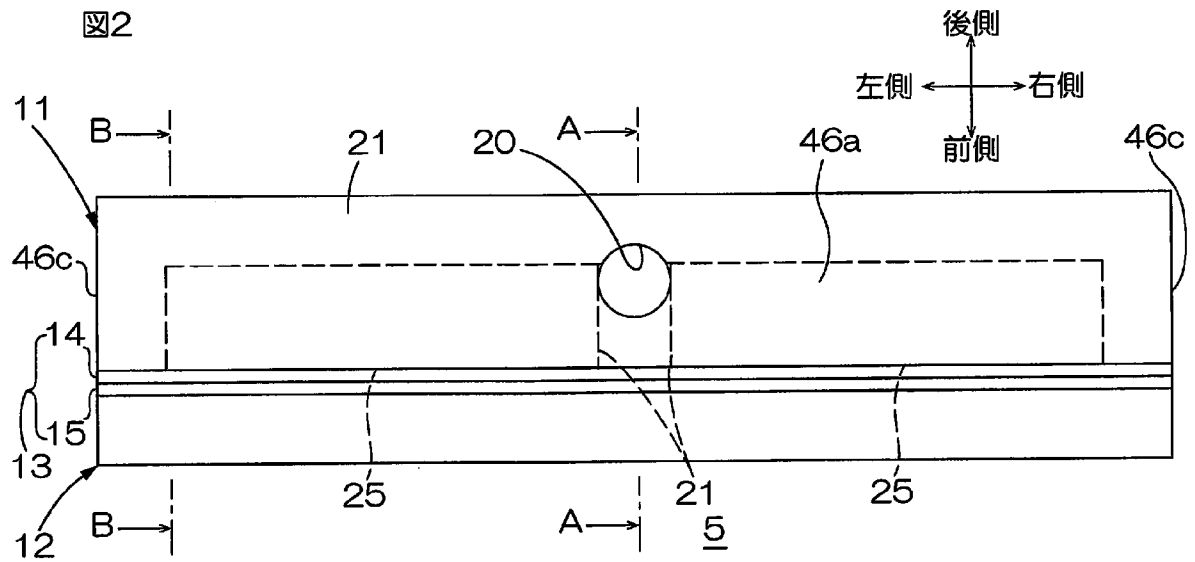
- [請求項1] 粒子および樹脂を含むワニスを塗布するための塗布装置であり、
ワニスを、吐出方向と直交する第1方向に広げるためのマニホールドと、
前記マニホールドによって前記第1方向に広げられたワニスを吐出するための吐出部と
を備え、
前記マニホールドには、前記第1方向長さが、前記吐出方向下流側に向かうに従って、次第に長くなる拡大部が設けられ、
前記吐出部には、前記吐出部の前記第1方向端部における前記ワニスの吐出を相対的に抑制するための吐出抑制部が設けられていることを特徴とする、塗布装置。
- [請求項2] 前記マニホールドは、
ワニスが流入され、前記吐出方向に対する直交方向に沿う開口断面積が、前記吐出方向下流側に向かうに従って拡大する流入部と、
前記流入部の前記吐出方向下流側に設けられ、ワニスが前記流入部から流出され、前記直交方向に沿う開口断面積が、前記吐出方向に向かうに従って縮小する流出部と
を備え、
前記拡大部は、前記流入部に設けられていることを特徴とする、請求項1に記載の塗布装置。
- [請求項3] 前記拡大部を区画するための、前記マニホールドに対して着脱可能なアタッチメント部材が、前記マニホールドの前記吐出方向上流側における前記第1方向端部に設けられていることを特徴とする、請求項1に記載の塗布装置。
- [請求項4] 前記拡大部を通過するワニスを目視することのできる透明部材を備えていることを特徴とする、請求項1に記載の塗布装置。

[図1]

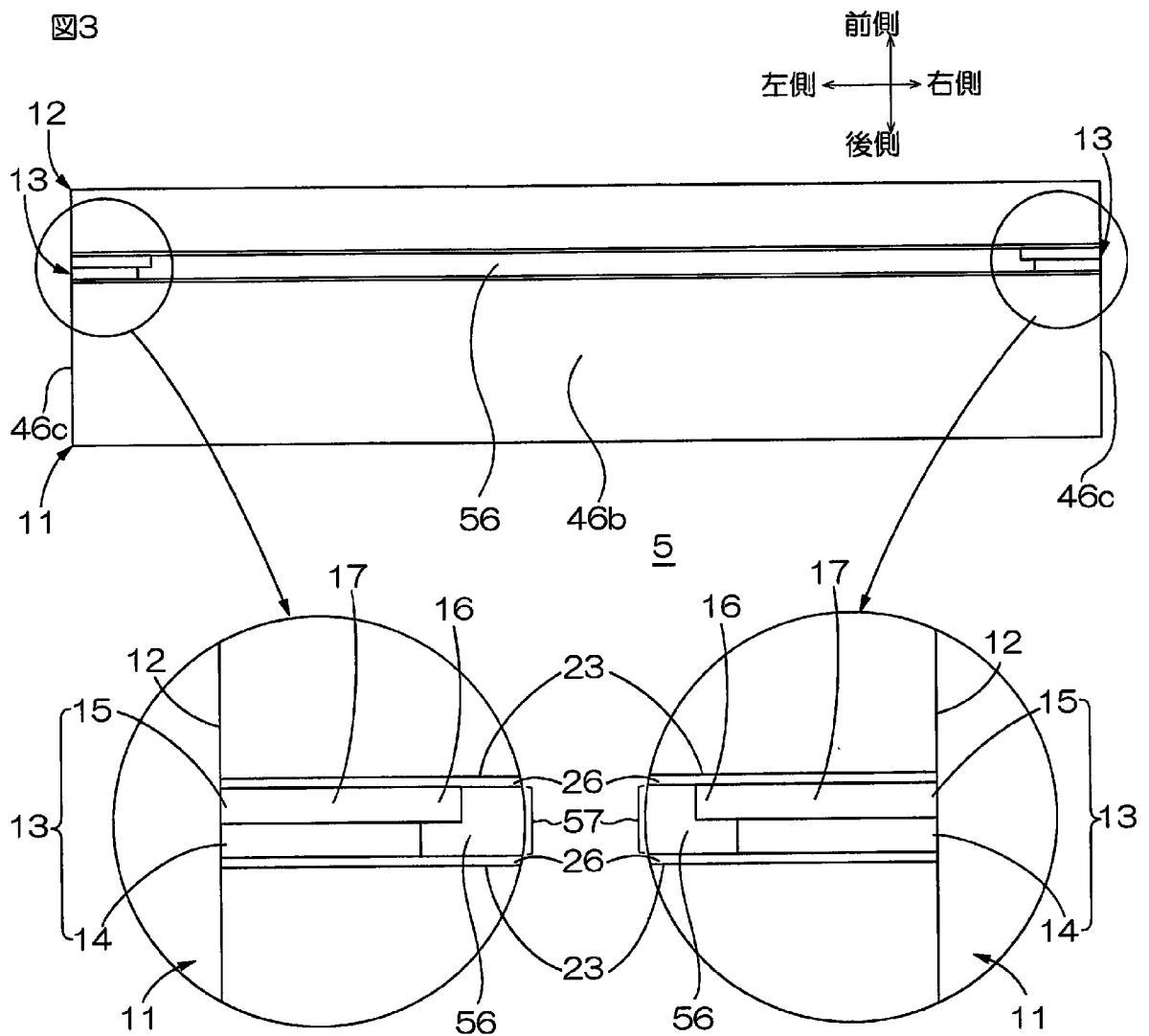
図1



[図2]

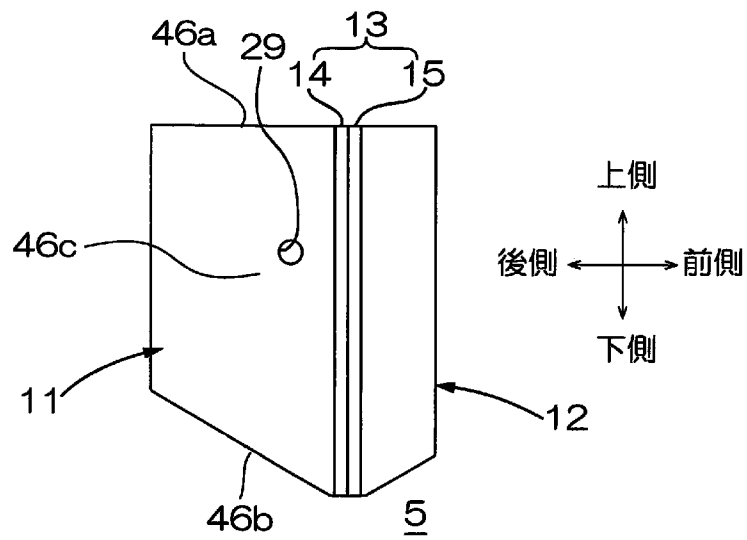


[図3]



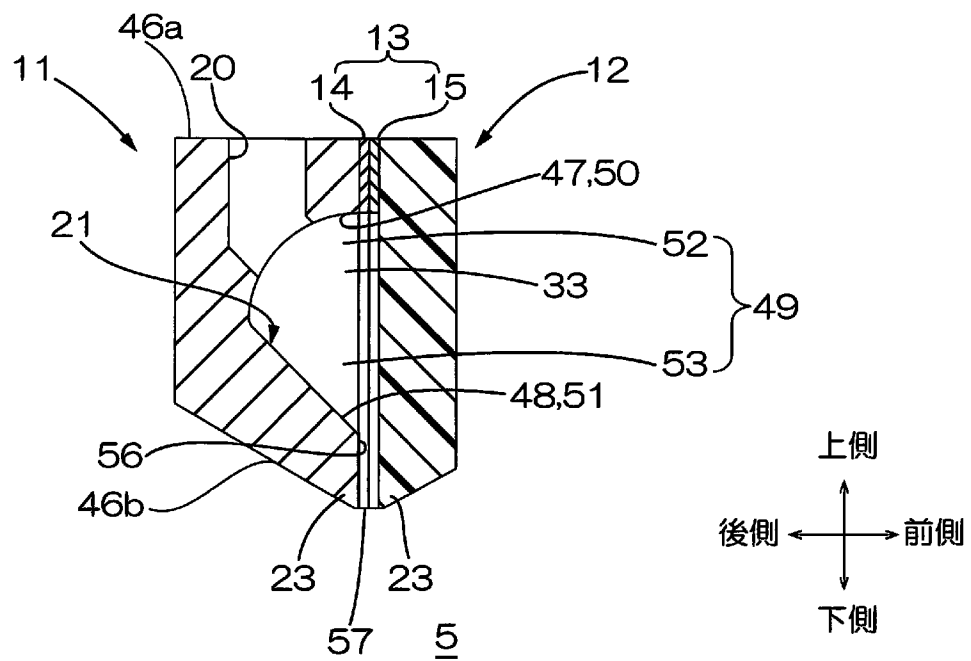
[図4]

図4



[図5]

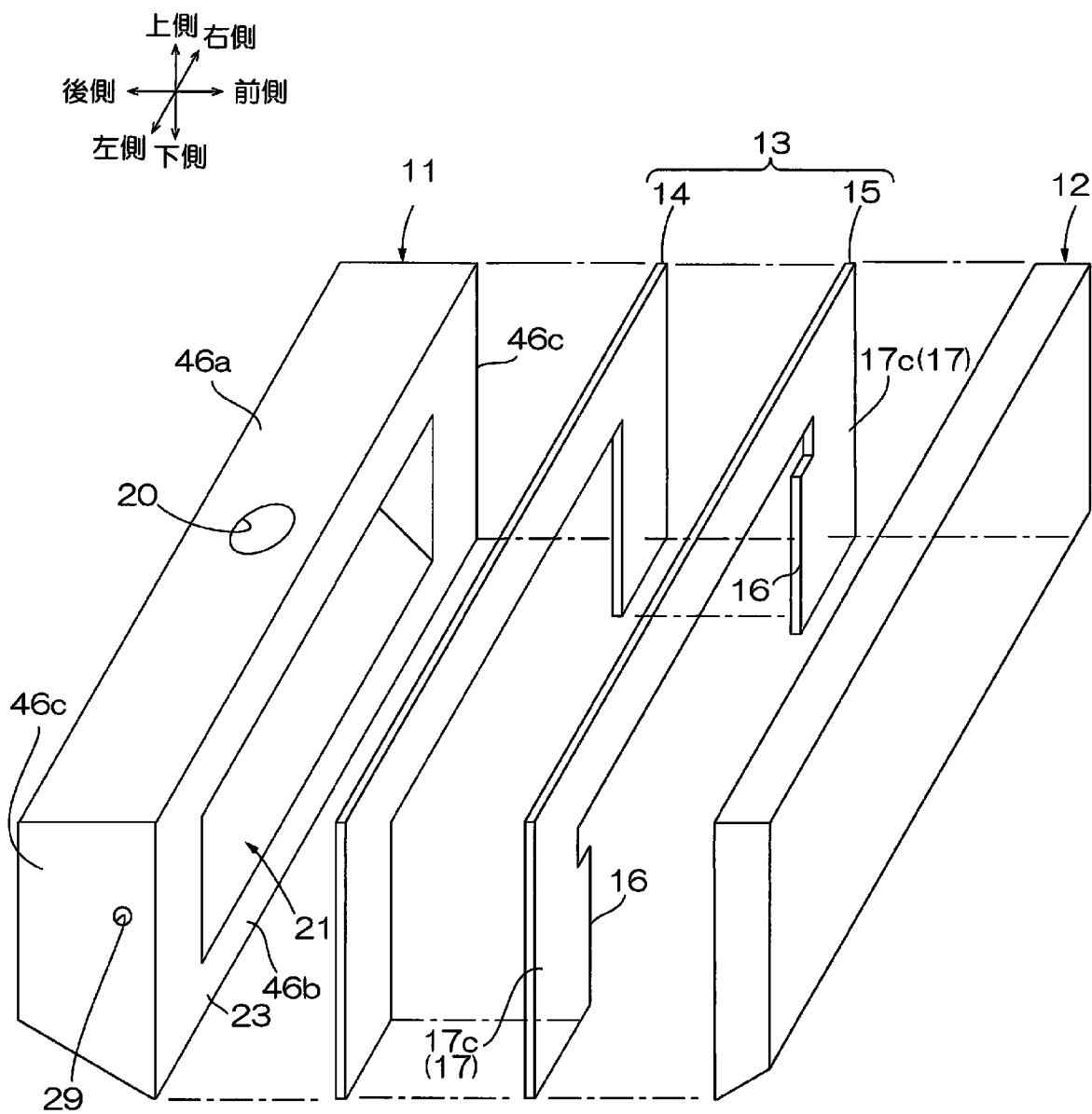
図5



[illegible]

[図8]

図8



[図9]

図9

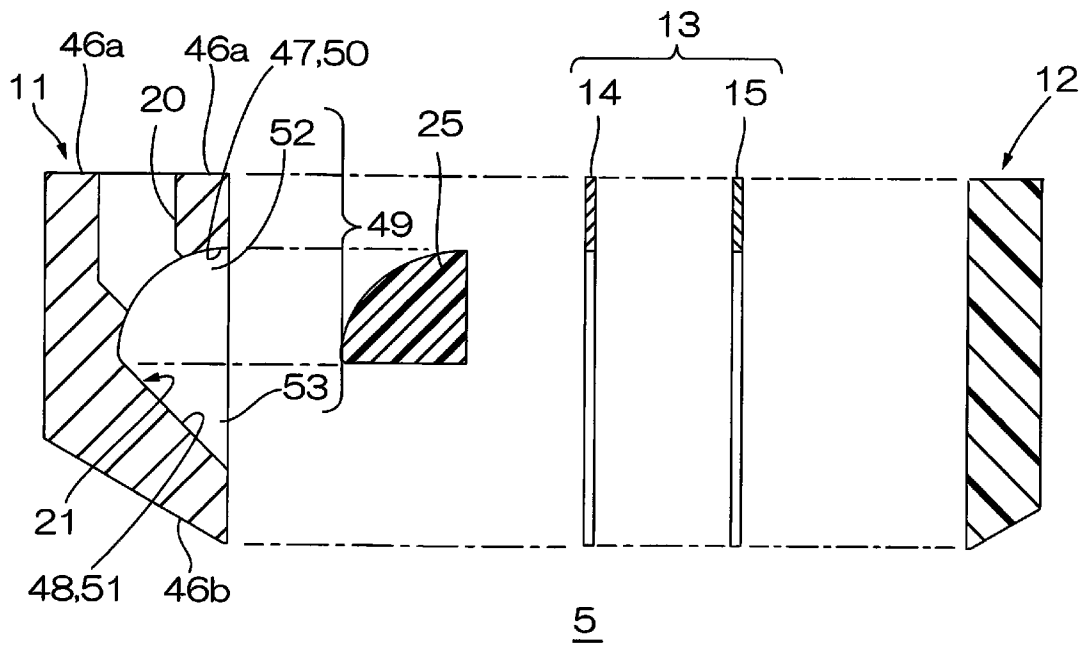
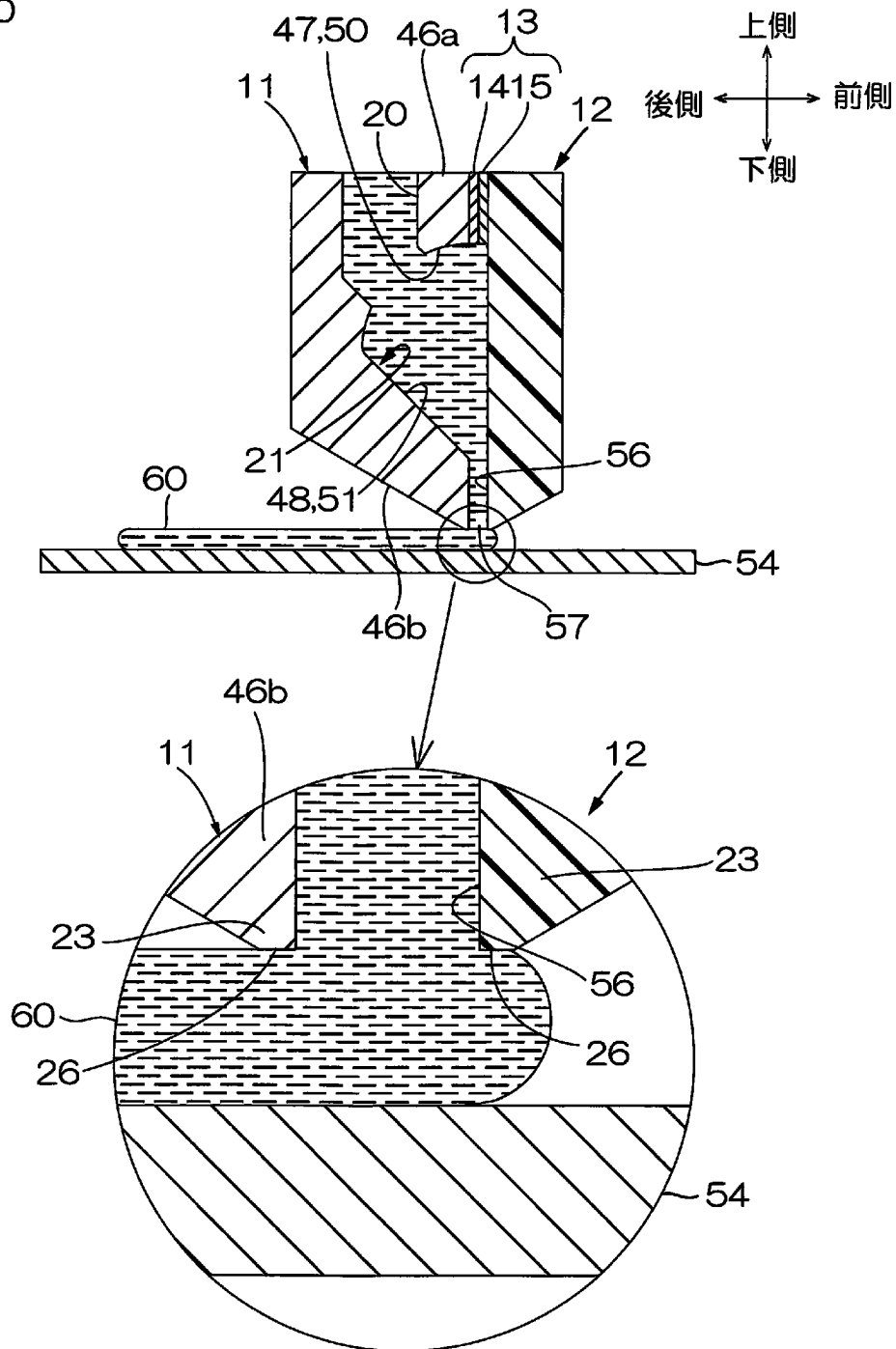
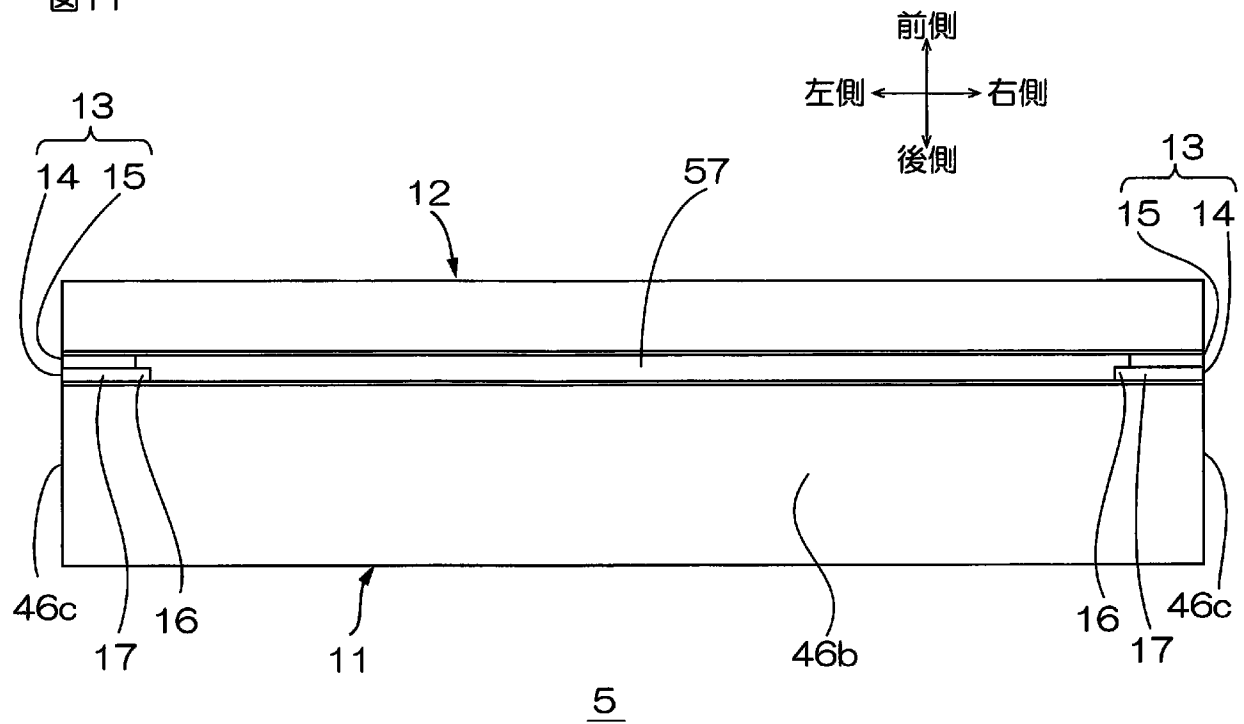


图10



[図11]

図11



[図12]

図12

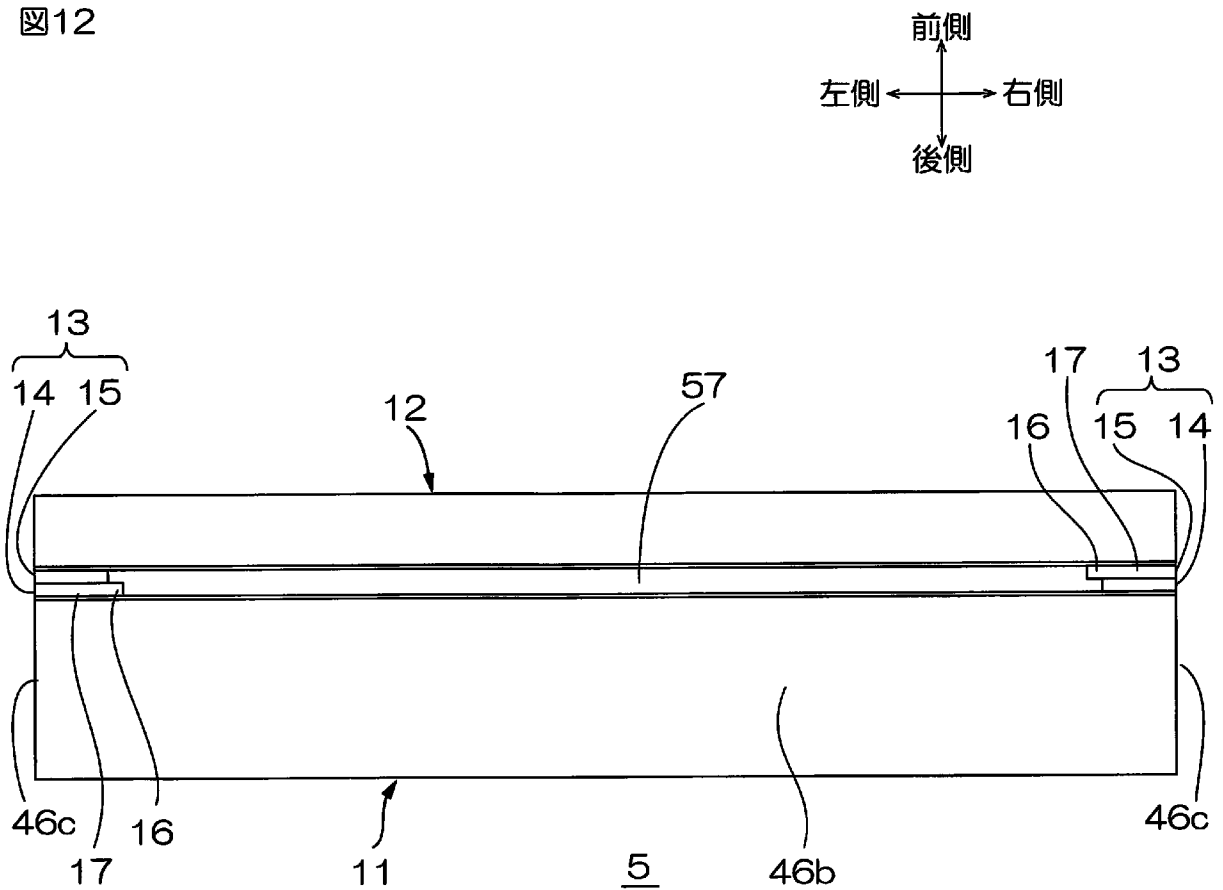


图13

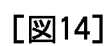
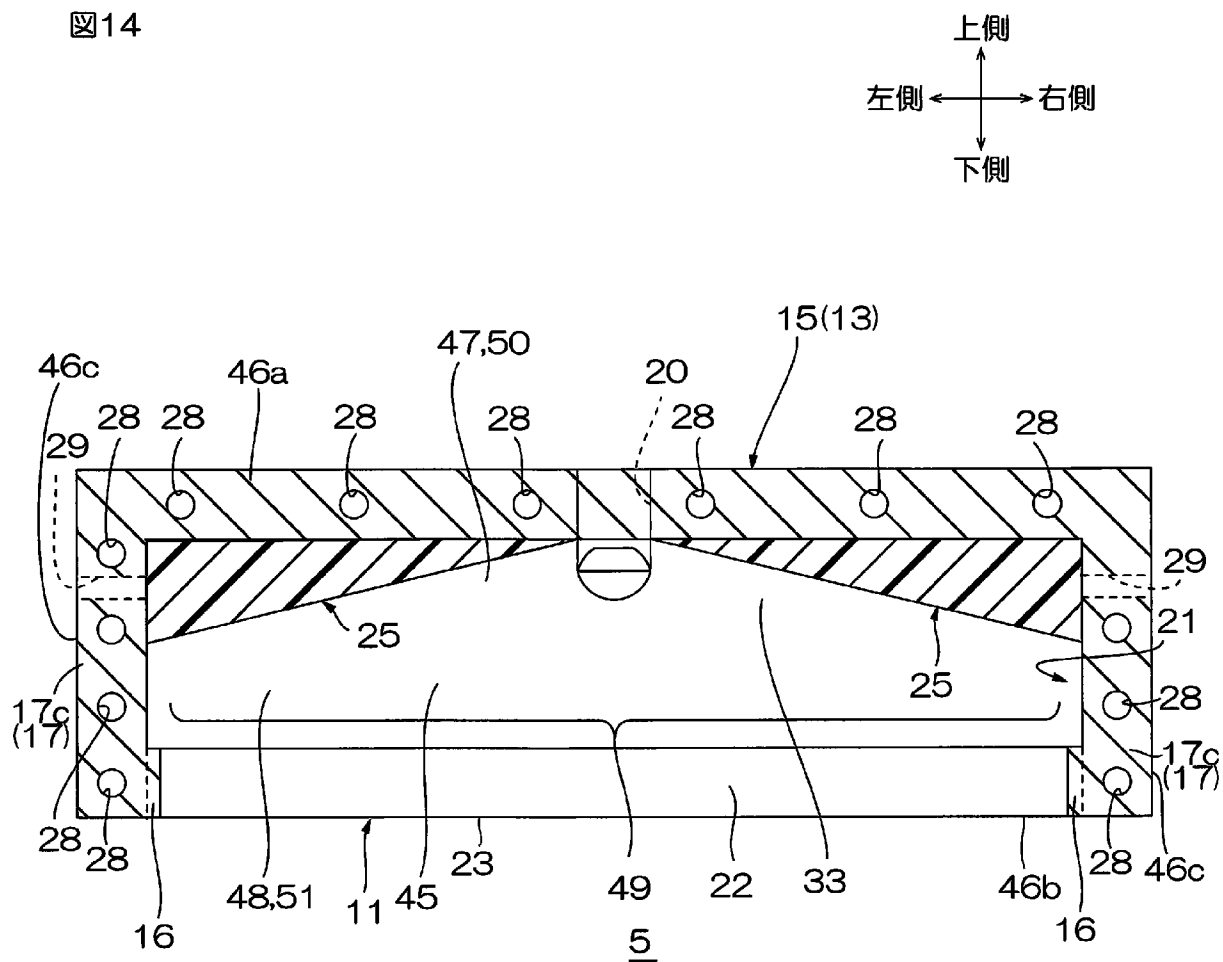


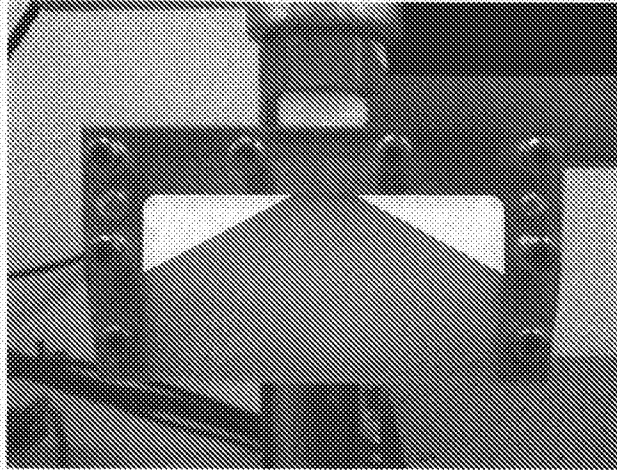
图14



[図15]

図15

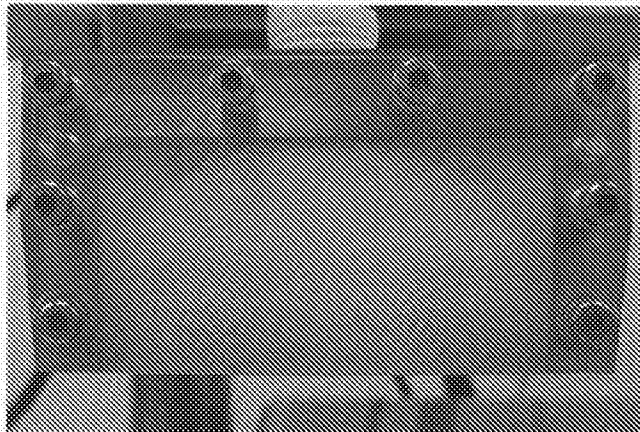
実施例1



[図16]

図16

比較例1（アタッチメント部材なし）



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/054215

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

B05C5/02(2006.01)i, B05C11/10(2006.01)i, H01M4/04(2006.01)n

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B05C5/02, B05C11/10, H01M4/04

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho	1922-1996	Jitsuyo Shinan Toroku Koho	1996-2014
Kokai Jitsuyo Shinan Koho	1971-2014	Toroku Jitsuyo Shinan Koho	1994-2014

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	JP 2010-086811 A (Toshiba Corp.), 15 April 2010 (15.04.2010), paragraphs [0006] to [0023]; fig. 1 to 3 (Family: none)	1-4
Y	JP 2009-273997 A (Panasonic Corp.), 26 November 2009 (26.11.2009), paragraphs [0020] to [0029]; fig. 1 to 3 (Family: none)	1-4
Y	JP 2008-140825 A (Toppan Printing Co., Ltd.), 19 June 2008 (19.06.2008), paragraphs [0068] to [0072]; fig. 1 to 3 (Family: none)	4

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.

☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
 "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date
 "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
 "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
 "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
 "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
 "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
 "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
15 May, 2014 (15.05.14)

Date of mailing of the international search report
27 May, 2014 (27.05.14)

Name and mailing address of the ISA/
Japanese Patent Office

Authorized officer

Facsimile No.

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2014/054215

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	JP 2010-051953 A (Hitachi Chemical Co., Ltd.), 11 March 2010 (11.03.2010), paragraphs [0026], [0092], [0097], [0099]; fig. 1, 3(c) (Family: none)	1-4
A	JP 2004-305955 A (Lintec Corp.), 04 November 2004 (04.11.2004), paragraphs [0026] to [0030]; fig. 1 to 2, 6 (Family: none)	1-4
P, A	JP 2013-202558 A (Nitto Denko Corp.), 07 October 2013 (07.10.2013), paragraphs [0023] to [0035]; fig. 1 to 4 (Family: none)	1-4

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. B05C5/02(2006.01)i, B05C11/10(2006.01)i, H01M4/04(2006.01)n

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（I P C））

Int.Cl. B05C5/02, B05C11/10, H01M4/04

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1 9 2 2 - 1 9 9 6 年
日本国公開実用新案公報	1 9 7 1 - 2 0 1 4 年
日本国実用新案登録公報	1 9 9 6 - 2 0 1 4 年
日本国登録実用新案公報	1 9 9 4 - 2 0 1 4 年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
Y	JP 2010-086811 A (株式会社東芝) 2010.04.15, 段落【0006】-【0023】, 図 1-3 (ファミリーなし)	1-4
Y	JP 2009-273997 A (パナソニック株式会社) 2009.11.26, 段落【0020】-【0029】, 図 1-3 (ファミリーなし)	1-4
Y	JP 2008-140825 A (凸版印刷株式会社) 2008.06.19, 段落【0068】-【0072】, 図 1-3 (ファミリーなし)	4

☒ C 欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の 1 以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

1 5 . 0 5 . 2 0 1 4

国際調査報告の発送日

2 7 . 0 5 . 2 0 1 4

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（I S A / J P）
郵便番号 1 0 0 - 8 9 1 5
東京都千代田区霞が関三丁目 4 番 3 号

特許庁審査官（権限のある職員）

篠原 将之

3 F

3 2 2 6

電話番号 0 3 - 3 5 8 1 - 1 1 0 1 内線 3 3 5 1

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
A	JP 2010-051953 A (日立化成工業株式会社) 2010. 03. 11, 段落【0026】 , 【0092】 , 【0097】 , 【0099】 , 図 1, 3(c) (ファミリーなし)	1-4
A	JP 2004-305955 A (リンテック株式会社) 2004. 11. 04, 段落【0026】 - 【0030】 , 図 1-2, 6 (ファミリーなし)	1-4
P, A	JP 2013-202558 A (日東電工株式会社) 2013. 10. 07, 段落【0023】 - 【0035】 , 図 1-4 (ファミリーなし)	1-4